1. 플라즈마 정의.

플라즈마란 전자, 이온 및 중성입자로 구성되어 있으며, 전기적으로는 중성인 성질을 가지고 있는 상태입니다. 플라즈마는 반도체의 다양한 공정에서 핵심 요소기술로 활용되는 기술입니다.

1. 플라즈마의 종류.
2. 플라즈마를 사용하는 이유.

플라즈마를 반도체 공정에 사용하는 이유는 크게 4가지입니다. 첫번째는 선폭의 미세화인데, 반도체가 집적됨에 따라서 습식식각의 등방성 식각으로는 높은 aspect ratio로 선폭 미세화를 할 수 없기 때문입니다. 따라서 비등방석 식각이 가능한 dry etch를 위해 플라즈마를 사용합니다.